

Praktikum 12: SCHICHT- UND BAUELEMENTE TECHNOLOGIE						ETIT-100
Turnus	Dauer	Studienabschnitt	LP	Präsenzanteil	Eigenstudium	
Halbjährlich	2 Wochen (Block)	4. / 5. Semester	3	48 h	42 h	
1	Modulstruktur					
	Nr.	Element / Lehrveranstaltung	LSF-Nr.	Typ	LP	Zeitstunden
	1	Vorbereitung (Einarbeitung in Schichttechnologien)			-	10
	2	Praktikum	08 0002	P	3	80
2	Lehrveranstaltungssprache Deutsch					
3	Lehrinhalte 1. Verfahren zur Dünnschichtabscheidung und -charakterisierung 2. Fotolithografische Strukturierung 3. Bauelementesimulation, Technologien und Charakterisierungen					
4	Kompetenzen Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über experimentelle Kenntnisse der Dünnschichttechnologien und der zugehörigen Charakterisierungsverfahren, der grundlegenden Prozesse der Planartechnologien für Bauelemente sowie deren Simulation und Charakterisierung.					
5	Prüfungen Herstellung und Charakterisierung einer Pseudo-MOSFETs mit anschließender Dokumentation des Herstellungsprozesses sowie nachvollziehbarer Analyse und Auswertung der Messergebnisse.					
6	Prüfungsformen und -leistungen <input type="checkbox"/> Modulprüfung <input type="checkbox"/> Teilleistungen					
7	Teilnahmevoraussetzungen Empfohlene Kenntnisse: Technologie (ETIT-004) Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Die Zulassung zur Teilnahme erfolgt gem. § 9 der Prüfungsordnung. Bei unentschuldigter Abwesenheit an einem früheren Praktikumstermin wird eine erneute Zulassung für den jeweiligen Teilnehmer/ jeweilige Teilnehmerin für das laufende Semester ausgesetzt.					
8	Modultyp und Verwendbarkeit des Moduls Wahlpflichtpraktikum im den Bachelorstudiengängen „Elektrotechnik und Informationstechnik“ sowie „Informations- und Kommunikationstechnik.“					
9	Modulbeauftragte/r Prof. Dr.-Ing. Stefan Tappertzshofen		Zuständige Fakultät Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik			